

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕДИ

Л. А. Сайпулаева^{a}, Ф. С. Габибов^a, Н. В. Мельникова^{b**}, А. Г. Алибеков^a,
О. Л. Хейфец^b, А. Н. Бабушкин^b, К. В. Курочки^b*

^a Институт физики Дагестанского научного центра им. Х. И. Амирханова Российской академии наук
367025, Махачкала, Россия

^b Уральский федеральный университет, Институт естественных наук
620000, Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 2 апреля 2012 г.

Представлены результаты исследований и анализа электрофизических и фотоэлектрических свойств сложных халькогенидов меди, а именно, CuSnAsSe₃, проявляющего сегнетоэлектрические свойства, и CuInAsS₃, обладающего ионной проводимостью. Установлены спектральные и температурные области фоточувствительности кристаллов. Из анализа кривых термостимулированной проводимости в CuInAsS₃ оценены величины глубины залегания центров захвата носителей, проявляющихся в условиях термической активации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Халькогениды меди ABCD₃ (A = Cu; B = Sn, In; C = As; D = S, Se) являются новыми объектами исследования. Соединения обладают интересными физическими свойствами: сегнетоэлектрическими, пироэлектрическими, фотоэлектрическими, оптическими [1–4] и являются на данный момент малоизученными. В частности, остаются неразрешенными такие аспекты свойств этих материалов, как спектральные области фоточувствительности, особенности проявления реализуемых в них дефектных состояний на спектрах в условиях оптического и термического возбуждения, природа и энергетические параметры уровней соответствующих локальных центров. Поэтому задачи, связанные с установлением причин проявления перечисленных выше особенностей, в комплексе с изучением электрических свойств, являются актуальными.

В данной работе представлены результаты первых исследований фото- и термоактивационных явлений (спектров фотопроводимости (ФП)), термостимулированной проводимости (ТСП), оптиче-

ского гашения фототока (ОГФ) в CuSnAsSe₃ и CuInAsS₃. Приведен также ряд результатов исследований температурных зависимостей электропроводности и диэлектрической проницаемости.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Синтез материалов осуществлялся сплавлением исходных (не ниже ОСЧ) компонент в кварцевых контейнерах с остаточным давлением 10⁻⁴ Па, заполненных сверхчистым аргоном до 0.5 · 10⁵ Па, из которых кислород удален с помощью отжига с титановой губкой в режиме ступенчатого нагрева. Максимальная температура синтеза составляла 1323 К. Для получения однородных по составу кристаллов проводился гомогенизирующий отжиг слитков при T = 1163 К. Рентгенографическая аттестация синтезированных соединений проводилась на рентгеновских дифрактометрах ДРОН-3 и Shimadzu XRD 6000 (монохроматическое излучение K_α на Cu). На дифрактограмме CuInAsS₃ присутствует серия линий структуры халькопирита, соединение CuSnAsSe₃ проиндцировано в моноклинной сингонии. Параметры решеток исследованных соединений представлены в таблице.

*E-mail: l.saypulaeva@gmail.com

**E-mail: nvm.melnikova@gmail.com

Таблица. Параметры решетки, электропроводность и диэлектрическая проницаемость CuSnAsSe_3 и CuInAsS_3

Соединение	Сингония и параметры решетки, нм	σ , $\Omega^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ ($T = 300$ К, $f = 10$ кГц)	ε ($T = 300$ К, $f = 10$ кГц)
CuInAsS_3	тетрагональная, $a = 0.55184$, $c = 1.10845$	10^{-5}	40
CuSnAsSe_3	моно-клинная, $a = 0.5098$, $b = 0.8617$, $c = 0.7139$, $\beta = 94.130^\circ$	$1.6 \cdot 10^{-2}$	300

Исследуемые в экспериментах образцы изготавливались из отдельных участков слитков. Контакты к образцам были получены нанесением индия на свежие сколы от моноблока, подвергнутого предварительно механической шлифовке и полировке.

Электрические свойства в области температур 78–400 К исследовались методом импедансной спектроскопии с помощью установки Solartron FRA 1174 и измерителя-анализатора импеданса RCL-2000 в области частот 10–200 кГц. Оценка электронной и ионной компонент проводимости в соединении CuInAsS_3 проводилась с помощью поляризационного метода Вагнера.

Исследования проводились в интервале температур 78–400 К с помощью автономного криостата замкнутого цикла с двухступенчатым криогенным рефрижератором DE-204SL, основанным на цикле Гиффорда–МакМагона, с использованием гелиевого водоохлаждаемого компрессора. Для предохранения исследуемого образца от окисления и уменьшения выхода летучих компонентов из объема образцов осуществлялась вакуумная откачка полости криостата до давления 10^{-2} Па и для улучшения теплообмена и повышения однородности температурного поля рабочая зона заполнялась гелием. Система контроля температуры включала датчики температуры криохладителя и образца. Точность измерения температур 0.2 К.

Низкотемпературные ($T = 90$ К) измерения спектров ФП в диапазоне $h\nu = 0.4$ –1.8 эВ выполня-

лись методом модуляции падающего на образец излучения при напряжениях из области линейности вольт-амперной характеристики темнового тока. Отдельные измерения спектров ФП были выполнены в условиях комбинированного возбуждения образцов последовательным примесным светом и стационарным светом от галогенной лампы (ГЛ).

Спектр ОГФ в CuInAsS_3 при $T = 90$ К измерялся в режиме постоянного тока и уровне фототока $I_{ft} = 1.5 \cdot 10^{-8}$ А, возбуждаемого излучением от ГЛ.

При изучении уровней локальных центров, реализуемых в исследуемых соединениях, использовался метод термостимулированной проводимости (ТСП) [5, 6]. Образец при низкой температуре ($T = 90$ К) возбуждался светом от ГЛ или лампы накаливания, под влиянием которого «ловушечные» центры переходили в неравновесное состояние. Затем образец нагревался с постоянной скоростью и регистрировалось изменение его проводимости. Сравнение результатов таких измерений и измерений без предварительного возбуждения образца позволяет обнаружить на кривой проводимости $I_{tsp} \sim f(T)$ пики, а при наложении нескольких пиков — широкие полосы, связанные с опустошением ловушечных центров.

Для выделения отдельных элементарных полос на кривой ТСП применялся метод термоочистки [7].

Энергетические глубины E_t залегания уровней определялись по начальному наклону кривых зависимостей $I_{tsp} = \text{const} \cdot \exp(-E_t/kT)$ [7], полученных при анализе исходной кривой ТСП.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Электрические свойства CuSnAsSe_3 и CuInAsS_3

Удельное сопротивление материалов, оцененное из измерений на постоянном токе при комнатной температуре, составило $\rho \approx 10^1$ – 10^2 Ом·м для CuSnAsSe_3 , $\rho \approx 10^2$ Ом·м для CuInAsS_3 . При исследовании электрических свойств высокоомных материалов существенное влияние на экспериментальные результаты оказывают процессы, связанные с блокированием носителей заряда на электродах, образованием и релаксацией объемных зарядов и приводящие кискажению величины измеряемых электрических характеристик. Метод импедансной спектроскопии позволяет выделить вклад электродных процессов в электропроводность. Анализ полученных результатов позволил выявить области частот, характеризующие объемные свойства образцов. Час-

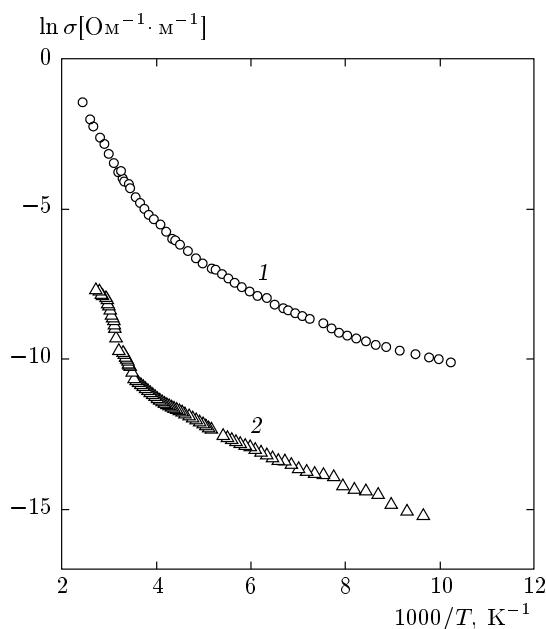


Рис. 1. Температурные зависимости удельной электропроводности CuSnAsSe_3 (1) и CuInAsS_3 (2)

стотные зависимости импеданса и адmittанса характеризуются присутствием двух хорошо разделяющихся частей: высокочастотной и низкочастотной. Высокочастотные части гидографов импеданса аппроксимируются дугами полуокружностей, проходящих через начало координат, и характеризуют свойства образца, низкочастотные характеризуют влияние электродного импеданса. Границные частоты (f_{gr}), в окрестности которых наблюдается переход от низкочастотной ветви к высокочастотной, с уменьшением температуры уменьшаются, а радиусы окружностей растут. При фиксированных частотах f переменного напряжения, принадлежащих области частот $f > f_{gr}$, где отсутствует дисперсия диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь, где влиянием электродных процессов можно пренебречь, изучены температурные зависимости импеданса, электропроводности и диэлектрической проницаемости.

Температурные зависимости удельной электропроводности и диэлектрической проницаемости соединений CuSnAsSe_3 и CuInAsS_3 , измеренные в области $f > f_{gr}$, представлены на рис. 1, 2. На температурной зависимости диэлектрической проницаемости CuSnAsSe_3 наблюдался максимум ($\varepsilon_{max} = 330$) при $T = 220$ К (рис. 2). Анализ температурных зависимостей электропроводности и диэлектрической проницаемости, а также большие значения ди-

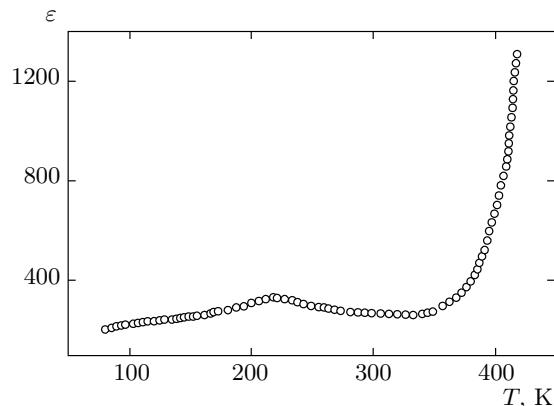


Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости CuSnAsSe_3

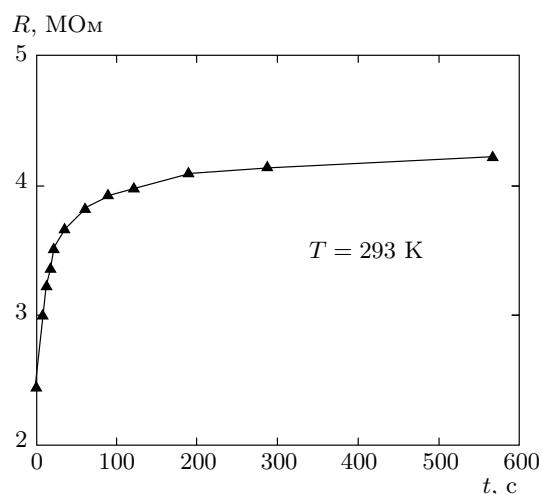


Рис. 3. Зависимость электросопротивления CuInAsS_3 от времени при постоянной разности потенциалов на ячейке

электрической проницаемости позволяют говорить о проявлении в CuSnAsSe_3 сегнетоэлектрических свойств. Быстрый рост диэлектрической проницаемости при увеличении температуры выше 250 К в соединении CuInAsS_3 , изменение значения энергии активации электропроводности выше 250 К (рис. 1, кривая 2), а также наблюдаемая зависимость электросопротивления от времени при приложении постоянной разности потенциалов к ячейке с двумя блокирующими ионный компонент электродами (рис. 3) являются типичными для ионных и электронно-ионных проводников.

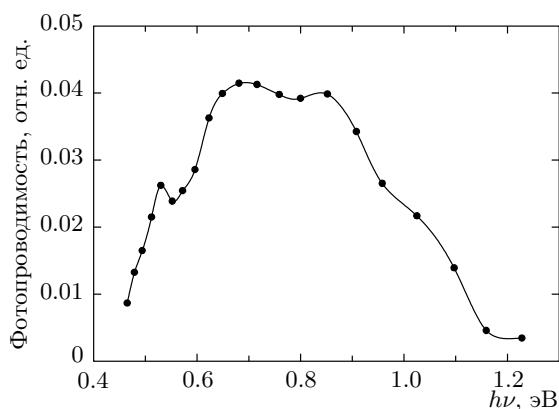


Рис. 4. Спектральное распределение ФП при $T = 90$ К в CuSnAsSe_3 (образец № 1). Охлаждение в темноте

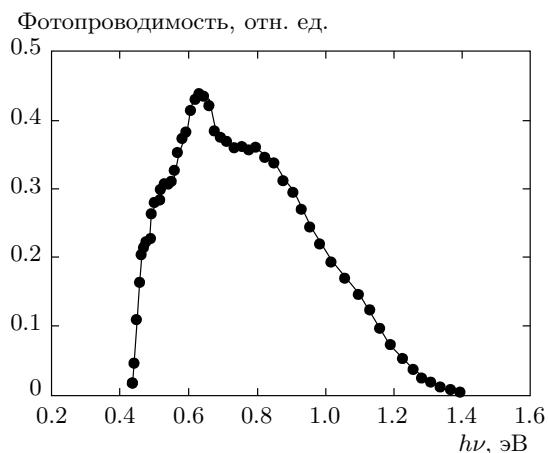


Рис. 5. Спектральное распределение ФП при $T = 90$ К в CuSnAsSe_3 (образец № 2). Охлаждение в темноте

3.2. Фотоэлектрические свойства соединений CuSnAsSe_3 и CuInAsS_3

Соединение CuSnAsSe_3

На рис. 4 и 5 представлены спектры ФП при $T = 90$ К в двух образцах, изготовленных из одного и того же моноблока кристалла CuSnAsSe_3 . На рисунках видно, что в области энергий возбуждающего излучения $h\nu \approx 0.4\text{--}1.4$ эВ спектральное распределение ФП носит сложный характер. На спектре образца № 1 наблюдались ряд полос с максимумами $h\nu_m \approx 0.53$, 0.69 , 0.84 эВ и структура вблизи $h\nu \approx 0.98$ эВ (рис. 4). На спектре образца № 2 полосы ФП менее разрешены (рис. 5), что указывает на неравномерность распределения соответствующих локальных центров в исходном кристалле CuSnAsSe_3 .

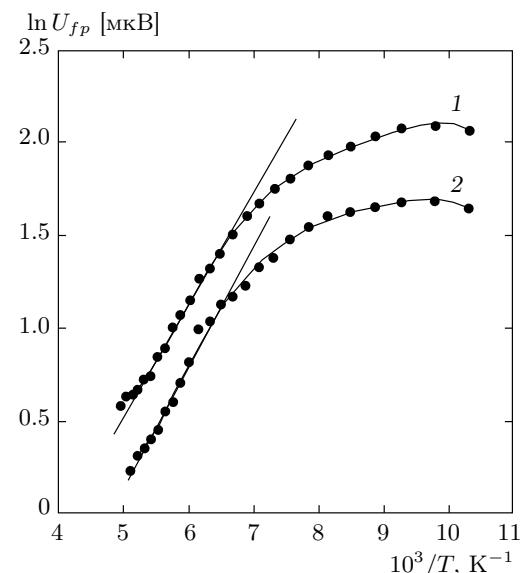


Рис. 6. Температурная зависимость ФП, возбуждаемой энергиями фотонов $h\nu = 0.649$ эВ (кривая 1) и $h\nu = 0.759$ эВ (кривая 2) из области фоточувствительности CuSnAsSe_3 (образец № 1), $E_a = 0.12$ эВ

Наблюдение серии полос на спектральном распределении ФП CuSnAsSe_3 в области фоточувствительности $h\nu \approx 0.4\text{--}1.4$ эВ свидетельствует о реализации в кристалле серии глубоких центров, проявляющихся при $T = 90$ К оптическую активность. Полагаем, что в роли этих центров могут выступать структурные дефекты кристалла типа вакансии, а также комплексы отдельных компонент.

Для установления термической стабильности центров, ответственных за полосы на спектрах, в частности, полосы $h\nu_m \approx 0.69$ эВ (рис. 4), исследовались температурные зависимости ФП при энергиях возбуждающих фотонов $h\nu \approx 0.649$, 0.759 эВ из областей на возрастающем и убывающем крыльях полосы $h\nu_m \approx 0.69$ эВ (рис. 6, кривые 1, 2). Из рисунка следует, что с ростом температуры сигналы ФП из области полосы $h\nu_m \approx 0.69$ эВ постепенно уменьшаются и при температурах $T > 200$ К кристалл CuSnAsSe_3 становится нефоточувствительным. Энергия активации гашения, оцененная по линейным участкам зависимости $\ln U_{fp} \propto f(10^3/T)$, в обоих случаях составляла $E_a \approx 0.125$ эВ.

Наблюданное падение ФП в CuSnAsSe_3 с ростом температуры, скорее всего, обусловлено термическим опустошением уровней соответствующих

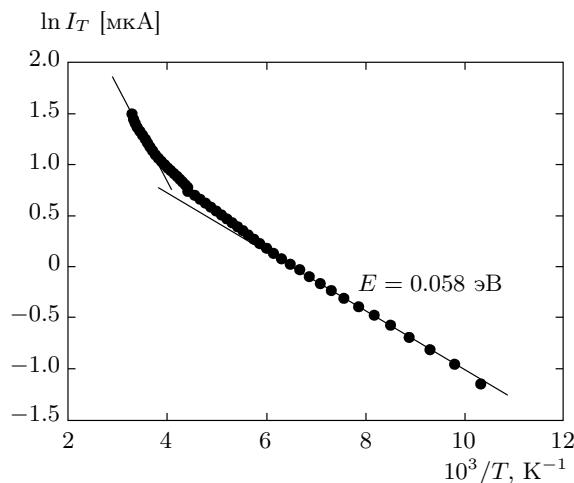


Рис. 7. Температурная зависимость темнового тока в CuSnAsSe₃ (образец № 1)

центров носителями, захваченными в процессе охлаждения до $T = 90$ К, и переходом образца в состояние с высокой проводимостью. Действительно, измерения показали, что исследуемый образец CuSnAsSe₃ (№ 1) после охлаждения в темноте при $T = 90$ К, при которой происходит замораживание носителей на центрах, имел удельное сопротивление $\rho \approx 5.4 \cdot 10^6$ Ом·м, тогда как уже при $T = 202$ К, когда кристалл становился нефоточувствительным, $\rho \approx 4.7 \cdot 10^2$ Ом·м. Последующее повышение температуры до $T = 295$ К приводило к дальнейшему понижению удельного сопротивления до $6.4 \cdot 10^1$ Ом·м, что почти на пять порядков меньше по сравнению с ρ при $T = 90$ К.

Таким образом, переход кристалла CuSnAsSe₃ в низкоомное состояние с ростом температуры является одной из причин потери его фоточувствительности и невозможности проведения измерений ФП при $T > 200$ К.

Температурная зависимость темнового тока CuSnAsSe₃ в интервале $T = 90$ –300 К носит активацационный характер (рис. 7). Следует отметить, что увеличение температуры образца, приводившее к падению сигналов ФП из областей наблюдения полос на спектре, сопровождалось возрастанием темнового тока I_T в интервале $T = 90$ –300 К (рис. 7). При этом в области $T = 90$ –166 К на зависимости $\ln I_T \propto f(10^3/T)$ наблюдался участок линейного роста тока с энергией активации $E_a \approx 0.06$ эВ. Последующий рост температуры приводил к увеличению скорости возрастания I_T и увеличению энергии активации ($E_a \approx 0.17$ эВ)

(рис. 7). Полагаем, что темновой ток обусловлен дырками, термически возбуждаемыми из акцепторных центров, которые расположены на 0.06–0.2 эВ выше потолка валентной зоны.

Гашение фотосигнала, связанного с центрами, ответственными за спектры ФП в CuSnAsSe₃, с ростом температуры является, возможно, следствием реализации и другого механизма. В частности, им может быть термически стимулированный распад оптически активных комплексов, формирующихся в процессе охлаждения образцов, с генерацией свободных носителей.

Как и в полупроводниках не с очень высоким сопротивлением (менее 10^3 Ом·м) [8], проведение измерений спектров ТСП в CuSnAsSe₃ ($\rho \approx 10^1$ – 10^2 Ом·м) было затруднено из-за высокого уровня темнового тока. Поэтому изучение особенностей проявления дефектных состояний в условиях термической их активации не представлялось возможным.

Таким образом, в поведении фотоэлектрических и электрических свойств материала CuSnAsSe₃ выявлена корреляция в исследованной области температур. Установлено, что при комнатной температуре кристалл не обнаруживает фоточувствительность в области $h\nu = 0.4$ –1.5 эВ и слабо реагирует на возбуждение интегральным светом. Предварительное освещение образца после охлаждения в темноте интегральным светом или светом от галогеновой лампы не приводило к наблюдению индуцированной неравновесной фотопроводимости, т. е. к неравновесному заполнению дефектных состояний, что позволяет предположить, что дефектные состояния, ответственные за спектральное распределение фотопроводимости, в процессе охлаждения находятся в заполненном носителями состоянии. Характер изменения фоточувствительности с изменением температуры может определяться эффектами, связанными с поляризацией, и сегнетоэлектрическими свойствами материала.

Соединение CuInAsS₃

Как упоминалось ранее, кристаллы CuInAsS₃ характеризовались более высокими удельными сопротивлениями ($\rho \geq 10^6$ Ом·м при $T = 295$ К), что позволяло проводить фотоэлектрические измерения в широком температурном интервале ($T = 90$ –300 К). Результаты комплекса фото- и термоактивационных исследований (ФП, ТСТ, ОГФ и $I_T \propto f(T)$) представлены ниже. Измерения проводились, как и в случае CuSnAsSe₃, на двух образцах (№ 1, № 2), изготовленных из одного моноблока.

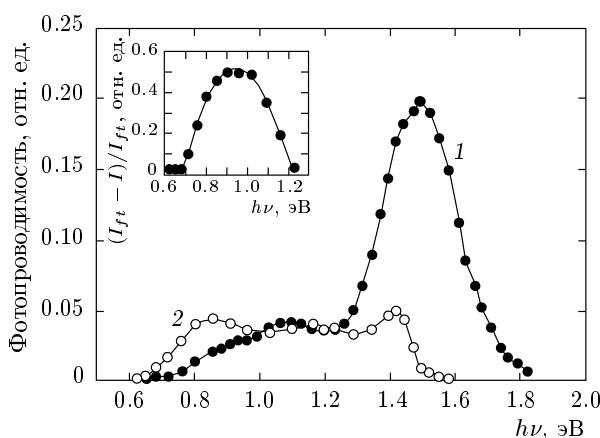


Рис. 8. Спектры ФП в CuInAsS₃ (образец № 1) при $T = 295$ К (кривая 1) и при $T = 90$ К (кривая 2). Спектр 2 измерен в присутствии постоянной подсветки от ГЛ. На вставке — спектр гашения фототока в CuInAsS₃

На рис. 8 приведены спектры ФП образца CuInAsS₃ (№ 1), измеренные при $T = 295$ К (кривая 1) и после охлаждения в темноте до $T = 90$ К (кривая 2). Как следует из рис. 8, кристалл при $T = 295$ К обнаруживает фотоочувствительность в широком интервале энергий $h\nu \approx 0.6\text{--}1.8$ эВ. При этом спектр ФП характеризуется интенсивной полосой $h\nu_m \approx 1.5$ эВ и размытой полосой со слабовыраженной структурой в низкоэнергетической области и с красной границей $h\nu_{red} \approx 0.65$ эВ. В рамках представлений о проявлении кристаллом CuInAsS₃ полупроводниковых свойств можно полагать, что полоса $h\nu_m \approx 1.5$ эВ обусловлена фотопроводимостью в области собственного поглощения. Ширина запрещенной зоны, оцененная по полуширине с длинноволновой стороны полосы $h\nu_m \approx 1.5$ эВ, составляла $E_g \approx 1.32$ эВ.

Наблюдение ФП при $T = 295$ К в низкоэнергетической области ($h\nu < 1.3$ эВ) спектра с $h\nu_{red} \approx 0.65$ эВ свидетельствует о присутствии в CuInAsS₃ (№ 1) локальных центров с глубокими уровнями, ответственных за эту ФП (рис. 8, кривая 1). На образце CuInAsS₃ (№ 2) ФП при $T = 295$ К в области $h\nu < 1.3$ эВ проявляется уже в виде хорошо разрешенной широкой полосы с $h\nu_m \approx 1.0$ эВ и полушириной $h\nu \approx 0.4$ эВ (рис. 9, кривая 1). Различие проявления низкоэнергетической ФП в образцах № 1, 2, скорее всего, является следствием концентрационного различия в распределении соответствующих дефектных состояний по объему кристалла.

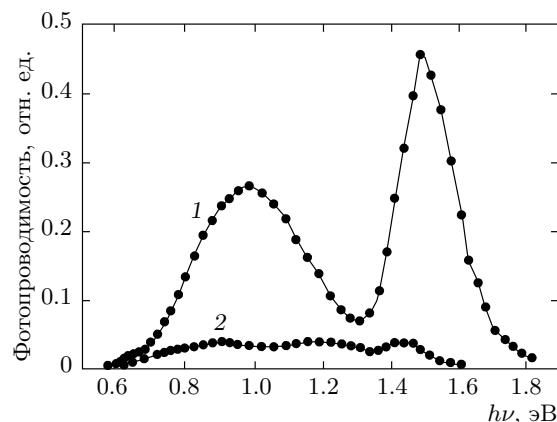


Рис. 9. Спектры ФП в CuInAsS₃ (образец № 2) при $T = 295$ К (кривая 1) и при $T = 90$ К (кривая 2). Спектр 2 измерен в присутствии постоянной подсветки от галогенной лампы

Понижение температуры до $T = 90$ К приводило к росту сопротивления образцов на несколько порядков ($R \geq 5$ ГОм) и соответственно резкому уменьшению сигналов ФП по всей области спектра. Поэтому измерения спектров ФП при $T = 90$ К проводились в условиях комбинированного возбуждения (последовательным излучением из области фотоочувствительности $h\nu \approx 0.6\text{--}1.8$ эВ и стационарным светом от галогеновой лампы) (рис. 8, 9, кривые 2) при поддерживании уровня фонового тока постоянным. Присутствие стационарной подсветки приводит к изменению таких параметров, определяющих фотопроводимость, как время жизни и подвижность неравновесных носителей заряда и, соответственно, к некоторому росту фотосигналов.

Как видно на рисунках, при $T = 90$ К с уменьшением фотоочувствительности по спектру одновременно обнаруживается температурное смещение ($h\nu \approx 0.03$ эВ) в сторону низких энергий как полосы собственной ФП, так и красной границы $h\nu_{red}$. При этом в области $h\nu < 1.3$ эВ на спектре проявляются полосы низкой интенсивности $h\nu_m \approx 0.85$ эВ и $h\nu_m \approx 1.13$ эВ, разделенные минимумом при $h\nu_{min} \approx 0.95$ эВ (кривые 2 на рис. 8 и 9).

Как показали наши исследования, в этой же области $h\nu < 1.3$ эВ в CuInAsS₃ (№ 1) при $T = 90$ К наблюдается оптическое гашение фототока (ОГФ). Спектральное распределение его при уровне фототока $I_{ft} = 1.15 \cdot 10^{-8}$ А приведено на вставке к рис. 8 и проявляется в виде полосы с $h\nu_m \approx 0.95$ эВ и $h\nu_{red} \approx 0.65$ эВ. Очевидно, наблюдение минимума при $h\nu_{min} \approx 0.95\text{--}1.0$ эВ на спектре ФП при $T = 90$ К

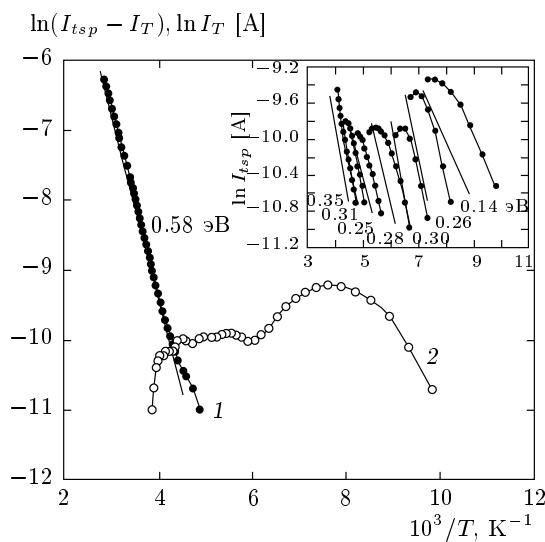


Рис. 10. Температурная зависимость темнового тока I_T (кривая 1) и термостимулированного тока после вычета I_T (кривая 2) в CuInAsS_3 (образец № 2). На вставке — кривые анализа ТСП методом термоочистки. Цифры на кривых — глубины залегания соответствующих уровней

является результатом влияния ОГФ. С другой стороны, совпадение областей проявления низкоэнергетической ФП как при $T = 295$ К, так и при $T = 90$ К и ОГФ, красных границ $h\nu_{red} \approx 0.65$ эВ в этой области, а также полуизолирующий характер образцов CuInAsS_3 позволяют сделать вывод о связи этих эффектов с глубокими компенсированными акцепторами с уровнем $E_{v+} = 0.65$ эВ, располагаемым почти в середине запрещенной зоны.

3.3. Термостимулированная проводимость в CuInAsS_3

В комплексе изучения свойств кристаллов CuInAsS_3 интерес представляет исследование термостимулированных явлений. В этом аспекте одним из наиболее распространенных методов получения информации, в частности, об уровнях нерекомбинационного захвата носителей является изучение кривых термостимулированной проводимости (ТСП) [5, 6].

На рис. 10, 11 приведены кривые ТСП в образцах CuInAsS_3 (№ 1, № 2) (кривые 2) после вычета влияния темнового тока, рост которого с увеличением T наблюдался в области $T > 202$ К (см. кривые 1). Температурные зависимости темнового тока $I_T \propto f(T)$ обнаруживали линейные участки с энергиями активации $E_a \approx 0.51\text{--}0.58$ эВ, что сви-

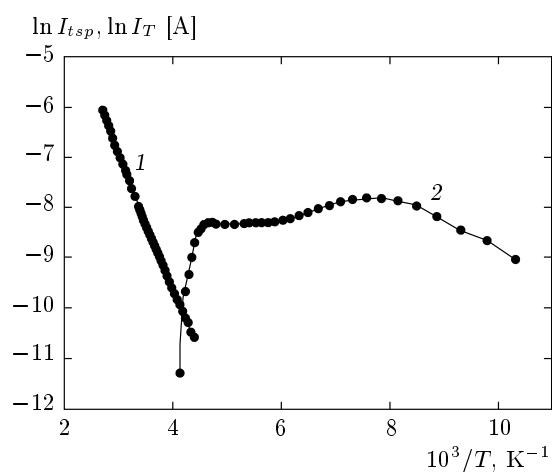


Рис. 11. Термостимулированная проводимость (кривая 1) и температурная зависимость темнового тока (кривая 2) в CuInAsS_3 (образец № 1)

детельствует о присутствии акцепторных центров с уровнями 0.51–0.58 эВ выше потолка валентной зоны. Термический перевод дырок с последних в валентную зону в области $T > 202$ К и обуславливает ход кривой зависимости $I_T \propto f(T)$ (кривые 1). При этом в определенном температурном интервале часть дырок из валентной зоны может быть захвачена центрами рекомбинации, на которых могут рекомбинироваться электроны, термически возбуждаемые с ловушечных центров, ответственных за спектр ТСП. Очевидно, это приведет к гашению ТСП в этой области температур. Важным доказательством этого является факт действительно наблюдения гашения на кривой ТСП в интервале $T \approx 220\text{--}250$ К (рис. 10, 11, кривые 2). А в области температур $T < 202$ К, где гашение ТСП не имело места, кривые в обоих образцах CuInAsS_3 обнаруживали близкое сходство, проявляясь с широкой пологой с максимумом вблизи $T \approx 127$ К (кривые 2).

Анализ кривой ТСП в CuInAsS_3 (№ 2) методом «термической чистки» приводит к выводу об ответственности за данный спектр системы квазидискретных уровней из интервала $E_c = 0.14\text{--}0.35$ эВ. Энергии ионизации E_t оценивались исходя из величины наклона начальных участков кривых ТСП, $\ln I_{tsp} \propto f$. Значения E_t ловушек в электронвольтах показаны вблизи соответствующих кривых ТСП.

Таким образом, одновременные исследования дефектных состояний в кристалле CuInAsS_3 оптическими и термическими методами показывают, что уровни $E_c = 0.14\text{--}0.35$ эВ по данным ТСП проявляются независимо от характера спектров ФП, т. е. в

условиях оптической активации, а обнаруживаются при термической активации, поэтому можно констатировать их термическую активность и отнести к медленным β -центрам прилипания электронов [5, 9].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлена корреляция в поведении фотоэлектрических и электрических свойств материала CuSnAsSe₃ в исследованной области температур. Установлено, что при комнатной температуре кристалл не обнаруживает фоточувствительности в области $h\nu = 0.4\text{--}1.5$ эВ и слабо реагирует на возбуждение интегральным светом. Предварительное освещение образца после охлаждения в темноте интегральным светом или светом от галогеновой лампы не приводило к наблюдению индуцированной неравновесной фотопроводимости, т. е. к неравновесному заполнению дефектных состояний, что позволяет предположить, что дефектные состояния, ответственные за спектральное распределение фотопроводимости ($T = 90$ К), в процессе охлаждения находятся в заполненном носителями состоянии. Характер изменения фоточувствительности с изменением температуры может определяться эффектами, связанными с поляризацией и сегнетоэлектрическими свойствами материала.

Определены глубины залегания центров захвата носителей в CuInAsSe₃, проявляющихся в условиях термической активации, методом ТСП.

Исследования выполнены частично в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

ЛИТЕРАТУРА

1. О. Л. Хейфец, Л. Я. Кобелев, Н. В. Мельникова, Л. Л. Нугаева ЖТФ **77**, 90 (2007).
2. O. L. Kheifets, N. V. Melnikova, and A. N. Babushkin, *Proc. Int. Conf. «Phase Transitions, Crit. and Nonlinear Phenomena in Condensed Matter»*, Makhachkala (2007), p. 334.
3. O. L. Kheifets, N. V. Melnikova, L. A. Saipulaeva et al., Book of Abs. 46th EHPRG Conf. (2008), p. 86.
4. O. L. Kheifets, N. V. Melnikova, A. N. Babushkin et al., Book of Abs. 46th EHPRG Conf. (2008), p. 117.
5. С. М. Рывкин, *Фотоэлектрические явления в полупроводниках*, Физматгиз, Москва (1963), с. 494.
6. В. Н. Вертопрахов, Е. Г. Сальман, *Термостимулированные токи в неорганических веществах*, Наука, Новосибирск (1979), с. 330.
7. I. Woods and K. H. Nicholas, Brit. J. Appl. Phys. **15**, 1361 (1964).
8. G. F. Garlik and A. F. Gibson, Proc. Phys. Soc. **69**, 574 (1948).
9. А. Милнс, *Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках*, Мир, Москва (1977), с. 562.